

## НАСТОЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ МЕТОДОМ РЕАКТИВНО-ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ



# НВУ ТМ ПЛАЗМА 01

### Назначение:

Травление тонких диэлектрических и металлических слоёв, а также полупроводниковых материалов методом реактивно-ионного травления.

### Особенности:

- Рабочая поверхность стола  $\varnothing$  116 мм (80x80);
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ в диапазоне 30-200 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>, CF<sub>4</sub>;
- Безмасляная система откачки (агрегат с ТМН60);
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 1,5 м<sup>2</sup>.

